

Etching Center V 200 und V 300

Zum Entwickeln, Ätzen, Neutralisieren, Spülen und Trocknen von ein- oder doppelseitigen Leiterplatten



Die Anlagen der Gerätereihe Etching Center V sind modular aufgebaute Durchlaufentwicklungs- und Schaumätzanlagen zur Herstellung von ein- oder zweiseitigen Leiterplatten und Formätzteilen.

Anlagenaufbau

- Schaumätzer, doppelseitig arbeitend
Schaumätzmodul mit integriertem Neutralisationsbecken:
 - Titanmantelheizkörper mit elektronischem Temperaturregler und Temperatursicherung
 - Digitale Zeitschaltuhr
- Umlaufentwickler, doppelseitig arbeitend:
Umlaufentwicklermodul mit integrierter Stand-/Sprühspüle:
 - Digitale Zeitschaltuhr
- Untergestell mit integrierter Sicherheitswanne
- Universalleiterplattenhalter
- Abquetschtrockner

Prozesstechnologie

Die Entwicklungs- und Ätzmodule können separat als Tischmodule oder zusammengefasst auf einem Untergestell, als Standgeräte betrieben werden.

Die zu behandelnde Platine wird in eine Klemmvorrichtung eingespannt und ohne umzuspannen durch den gesamten Entwicklungs-, Ätz- und Spül-Prozess geführt. Durch die kontinuierliche Kreislaufführung von Entwickler- und Schaumätzlösung ist ein schnelles und gleichmäßiges Entwickeln und Ätzen der Platinen möglich.

Die Anlagen der Gerätereihe ETCHING CENTER V sind für die Prototypen- und Kleinserienfertigung bis zu einer Plattengröße von 200 x 300 mm oder 300 x 400 mm geeignet. Qualitativ hochwertige Leiterplatten mit einer Leiterplatten-Strukturen von < 100 µm können in einer kurzen Bearbeitungszeit hergestellt werden.

Die Anlagen sind mit Mehrfachspülen ausgerüstet und zeichnen sich durch ihre saubere und kompakte Arbeitsweise aus. Durch den modularen Aufbau können die Geräte mit div. Zusatzmodulen zur Oberflächenbehandlung erweitert werden.



Etching Center V 200 und V 300

Zum Entwickeln, Ätzen, Neutralisieren, Spülen und Trocknen von ein- oder doppelseitigen Leiterplatten

Anlagenvorteile:

- Einfache Prozessführung
- Platinen werden im Universalplattenhalter ohne umzuspannen entwickelt-gespült-geätzt-gespült
- Schnelle und gleichmäßige Entwicklung und Ätzung der Kreislauf-führung von Entwickler- und Schaumätzlösung
- Kompakte und bedienerfreundliche Bauweise
- Stabiles Untergestell mit integrierter Sicherheitswanne
- Ablassen verbrauchter Lösungen nach vorne über Kugelhahn mit Schlauchanschluss
- Mehrfachspültechnik und verschleppungsarme, saubere Arbeitsweise gemäß Wasserhaushaltsgesetz

Lieferbares Zubehör

Div. Zusatzmodule wie z.B. Strippermodul, Durchlaufrockner AIR 2000 nach dem Nassprozess (Einzelgerät)

Technische Daten

| | Etching Center komplett mit Entwickler Stand-/Sprühpülung Schaumätzer Neutralisationsbecken Abquetschtrockner Untergestell mit Sicherheitswanne | | Entwickler mit Stand-/Sprühpülung | | Schaumätzer mit Neutralisationsbecken | |
|-------------------------|---|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | V 200 | V 300 | V200 | V300 | V200 | V300 |
| Arbeitsfläche | 200 x 300 mm | 300 x 400 mm | 200 x 300 mm | 300 x 400 mm | 200 x 300 mm | 300 x 400 mm |
| Arbeitshöhe | 1000 mm | 1000 mm | Table module | Table module | Table module | Table module |
| Inhalt Entwickler | 5 l | 7 l | 5 l | 7 l | – | – |
| Inhalt Schaumätzer | 10 l | 16 l | – | – | 10 l | 16 l |
| Inh. Entgiftungsbecken | 17 l | 27 l | – | – | 17 l | 16 l |
| Inhalt Spülbecken | 10 l | 20 l | 20 l | 20 l | – | – |
| Gewicht | 42 kg | 13 kg | 25 kg | 17 kg | 18 kg | 23 kg |
| Universal clamp | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektr. Anschluss | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme | Ca. 300 W | Ca. 400 W | 35 W | 35 W | 270 W | 370 W |
| Aufheizzeit ca. | 1,4 | 1,6 | – | – | 1,4 | 1,6 |
| Abmessungen (L x T x H) | 660x520x– mm | 660x620x– mm | 260x520x440 mm | 260x620x540 mm | 400x520x440 mm | 400x620x540 mm |

